МРНТИ 29.19.31

Алмасов Н.Ж.¹, Дюсембаев С.А.¹, Толепов Ж.К.¹, Усенбай С.К.^{1*}, Кадиров А.И.¹, Кейкиманова М.Т.²

¹НИИЭТФ КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан ²Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, г. Тараз, Казахстан *e-mail: usenbay94@mail.ru

СТРУКТУРА И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК GST

В работе представлены результаты исследований структуры и оптических свойств наноразмерных пленок толщиной от 50 до 175 нм системы GST состава Ge₂Sb₂Te₅. Пленки получались на подложках при комнатной температуре методом ионно-плазменного магнетронного распыления поликристаллической мишени Ge₂Sb₂Te₅ в атмосфере аргона при давлении ~1 Па и скорости осаждения ~0,3 нм/с. Морфология и состав пленок контролировались методами сканирующей электронной микроскопии и энерго-дисперсионного анализа. Установлено, что в составе пленок наблюдается некоторое превышение содержания атомов германия и недостаток атомов теллура по сравнению с формульным соотношением. Структура пленок исследовалась методом просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения. Установлено, что пленки являются сплошными и имеют типичную аморфную структуру с ближним порядком. Из спектров оптического пропускания и отражения света пленок рассчитаны спектральные зависимости коэффициентов поглощения. Установлено, что для наноразмерных пленок Ge₂Sb₂Te₌ в области фундаментального поглощения выполняется квадратичный закон Тауца. Показано, что оптическая ширина запрещенной зоны пленок существенно зависит от их толщины. С уменьшением толщины пленок от 175 до 50 нм их оптическая ширина запрещенной зоны значительно возрастает от 0,63 до 0,96 зВ.

Ключевые слова: структура, аморфные пленки Ge₂Sb₂Te₅, оптические свойства, оптическая ширина запрещенной зоны.

Almasov N.Zh.¹, Dusembayev S.A.¹, Tolepov Zh.K.¹, Ussenbay S.K.^{1*}, Kadirov A.I.¹, Keikimanova M.T.² ¹IETP Al Farabi Kazakh national university, Almaty, Kazakhstan ²M.Kh. Dulaty Taraz State University, Taraz, Kazakhstan *e-mail: usenbay94@mail.ru

Structure and optical properties of GST

The work presents the results of studies of structure and optical properties of nanoscale films with thickness from 50 to 175 nm of the GST system of the Ge2Sb2Te5 composition. The films were obtained on substrates using ion-plasma magnetron sputtering of a polycrystalline Ge2Sb2Te5 target in argon atmospheres at a pressure of ~ 1 Pa and a sedimentation rate of ~ 0.3 nm / s. Morphology and composition of films controlled by the method of scanning electron microscopy and energy-dispersion analysis. It is established that, in accordance with the illegal treatment against the abuse of alcohol and drugs. The structure of the films was studied by high-resolution transmission electron microscopy. It was found that the films are continuous and have a typical amorphous structure with short-range order. Spectral dependences of the absorption coefficients are calculated from the spectra of optical transmission and reflection of light of the films. It is established that for the nanosized Ge2Sb2Te5 films in the fundamental absorption region the quadratic Tautz law is satisfied. It is shown that the optical width of the band gap of films depends substantially on their thickness. With a decrease in the thickness of the films from 175 to 50 nm, their optical width of the forbidden band increases significantly from 0.63 to 0.96 times.

Key words: structure, amorphous Ge₂Sb₂Te₅ films, optical properties, optical band gap.

Алмасов Н.Ж.¹, Дюсембаев С.А.¹, Төлепов Ж.К.¹, Үсенбай С.К.^{1*}, Кадиров А.И.¹, Кейкіманова М.Т.²

¹ЭТФҒЗИ әл-Фараби ат. ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан ²М.Х. Дулати ат. Тараз мемлекеттік университеті, Тараз қ., Қазақстан ^{*}e-mail: usenbay94@mail.ru

GST жұқа қабыршақтардың құрылымы мен оптикалық қасиеттері

Жұмыста ионды-плазмалық магнетронды тозандату әдісімен алынған қалындықтары 50-ден 175 нм-ге дейін, наноөлшемді Ge,Sb,Te, құрамындағы GST жұқа қабыршақтардың, құрылымы мен оптикалық қасиеттерін зерттеу нәтижелері келтірілген. Қабыршақтар бөлме температурасында Ge,Sb,Te, поликристалдық нысананы ионды-плазмалық магнетронды тозандату әдісімен қысымы ~1 Па аргон газының атмосферасында және отырғызу жылдамдығы ~0,3 нм/с алынды. Қабыршақтардың морфологиясымен құрамы сканерлеуші электрондық микроскопия және энергодисперсионды әдістерімен бақыланды. Қабыршақтардың құрамында формулалық қатынастан тыс германий атомдарының басымдылығы және теллур атомдарының жеткіліксіздігі анықталған. Қабыршақтардың құрылымы ажырату қабілеттілігі жоғары жарықтандырушы электрондық микроскопиясы арқылы зерттелді. Қабыршақтар тегіс және жақын ретінің құрылымы қарапайым аморфті екендігі анықталды. Қабыршақтардың жарықты оптикалық откізу, және шағылдыру спектрлерінен жұтылу коэффицентерінен спектралдық тәуелдіктері есептелді. Ge,Sb,Te, наноөлшемдік қабыршақтары үшін іргелі жұтылу аумағында Тауцтың квадраттық заңдылығы орын алады. Қабыршақтардың тиым салынған аумағының оптикалық ендері олардың қалындығына елеулі түрде тәуелді екендігі көрсетілді. Қабыршақтардың қалындығы 175 нм-ден 50 нм дейін төмендегенде олардың тиым салынған аумағының оптикалық ендері 0,63-тен 0,96 эВ-қа артады.

Түйін сөздер: құрылым, Ge $_2$ Sb $_2$ Te $_5$ аморфты қабыршақтар, оптикалық қасиеттер, тиым салынған аумақтың оптикалық ені.

Введение

Материалы на основе халькогенидных стеклообразных полупроводников находят широкое применение в микро-, опто- и наноэлектронике. В частности, пленки на основе соединений Ag-In-Sb-Te и Ge-Sb-Te (GST) активно применяются для оптической записи информациив на CD, DVDи Blu-rayносителях [1]. Запись информации в вышеназванных носителях основана на процессе обратимого фазового перехода материала халькогенидного стеклообразного полупроводника из аморфного состояния в кристаллическоепод воздействием коротких импульсов лазерного излучения [2,3]. Параметры записи информации зависят от структурыи оптических свойств пленок, которые, в свою очередь, определяются методом их получения.

В работе приведены результаты исследования структуры и оптических свойств тонких наноразмерных пленок Ge₂Sb₂Te₅, полученных методом ионно-плазменного магнетронного распыления.

Методика приготовления пленок

Тонкие пленки Ge₂Sb₂Te₅ получались методом ионно-плазменного магнетронного распылениямонолитной поликристаллической мишени состава Ge₂Sb₂Te₅ химической чистотой 99,999% фирмы AciAlloys (USA). Параметры технологического процесса приготовления пленок отрабатывались таким образом, чтобы получались пленки с аморфной структурой и составом, соответствующим исходному составу мишени. Пленки получались в атмосфере аргона при давлении ~1 Па на модернизированной установке ВУП-4. Ускоряющее напряжение составляло 400 В, скорость осаждения пленок ≈0,3 нм/с. Пленки осаждались на подложки, находящиеся при комнатной температуре. В качестве подложек использовались кварц, монокристаллический кремний и полиимидные пленки «Карton», которые предварительно подвергались химической и термической обработке.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Состав и толщина пленок контролировались методами сканирующей электронной микроскопии на СЭМ Quanta 3D 200i с энерго-дисперсионным анализатором. Результаты этих исследований приведены на рисунках 1 и 2 соответственно.

Было установлено, что исследуемые пленки не содержат неконтролируемых примесей и в их составе наблюдается некоторое превышение содержания атомов германия и недостаток атомов теллура по сравнению с фрмульным соотношением.

Из СЭМ снимков выявлено, что поверхность пленок сплошная и однородная.

Толщина пленок определялась при сканировании электронным пучком скола структуры кристаллический кремний-пленка $Ge_2Sb_2Te_5$ (рисунок 2) и составляла 50, 100 и 175 нм.

Просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения (ПЭМ ВР) пленок проводилась на FeiTitan,оснащенным полиэмиссионным холодным катодом (Field Emission Cathode) и гексапольным корректором изображения(CEOScorrector).Точечное разрешение составляло <0,1 нм. Подаваемое напряжение составляло 300 кВ, ток пучка несколько нА. Результаты ПЭМ ВР приведены на рисунке 3.



Wt% – весовой процент; At% – атомный процент

Рисунок 1 – Типичный энерго-дисперсионный спектр характеристического излучения (а), химический состав и микрофотография (б) пленки Ge₂Sb₂Te₅.



Рисунок 2 – Микрофотография скола структуры с-Si-пленкаGe₂Sb₂Te₅: 175 nm(a), 100 nm (б) и 50 nm (в)

На электронограмме отчетливо проявляются диффузные дифракционные кольца, характерные для аморфной структуры. Пленки являются сплошными и имеют типичную аморфную структуру с ближним порядком, Для выявления влияния размерного эффекта на оптические свойства пленок $Ge_2Sb_2Te_5$, регистрировались спектры оптического пропускания $T(\lambda)$ и отражения $R(\lambda)$ (рисунки 4 и 5) при комнатной температуре в интервале длин



a)

B)

ный закон поглощения Тауца $(ahv)^{1/2} \sim (hv - E_g)$, вычислялась оптическая ширина запрещенной зоны E_g [4,5].



Рисунок 3 – Электронограмма (а) и ПЭМ ВР-изображенияпленок Ge₂Sb₂Te₅ с разрешением 100 нм (б), 20 нм (в), 5 нм (г)



Рисунок 4 – Спектры оптического пропускания Наноразмерных пленок Ge₂Sb₂Te₅

При известных значениях толщины пленок l, коэффицентов пропускания $T(\lambda)$ и отражения $R(\lambda)$ из спектральных характеристик пропускания света, рисунок 6, определялся коэффициент поглощения α :

$$\alpha(\lambda) = -1/l \cdot \ln \{T(\lambda)/(1-R(\lambda)^2\}.$$

Оптическая ширина запрещенной зоны E_g определялась из спектральных зависимостей коэффициента поглощения α , рисунок 7, в области, соотвествуещей краю полосы фундаментального поглощения путем экстрополяции экспериментальных зависимостей $(ahv)^{1/2}=f(hv)$ на ось энергий (рисунок 8). Погрешность в определении E_g определялась разбросом значений от образца к образцу и составляла ± 0,01 эВ.



Рисунок 5 – Зависимость коэффициента отражения наноразмерных пленок Ge₂Sb₂Te₅ от длины волны







Рисунок 7 – Зависимость коэффициента поглощения α от энергии фотоновдля пленок Ge₂Sb₂Te₅ с разной толщиной



Рисунок 8 – Спектральная зависимость края оптического поглощения наноразмерныхпленок Ge₂Sb₂Te₅



Рисунок 9 – Зависимость оптической ширины запрещенной зоны пленок Ge₂Sb₂Te₅ от их толщины

Толщинные зависимости оптической ширины запрещенной зоны приведены на рисунке 9 и в таблице 1.

Таблица 1 – Значения оптической ширины запрещенной зоны пленок $Ge_2Sb_2Te_5$

Состав	Толщина пленок, нм	<i>Е</i> _{g,} эВ
Ge ₂ Sb ₂ Te ₅	50	0,96
	100	0,67
	175	0,63

Из рисунка 9 и таблицы 1 следует, что с уменьшением толщины пленок $Ge_2Sb_2Te_5$ оптическая ширина запрещенной зоны пленок существенно возрастает, т.е. наблюдается выраженный размерный эффект.

Отметим, что подобное изменение оптических параметров пленок наблюдалось в работе [6], где для оценки оптической ширины запрещенной зоны пленок наноразмерной толщины была показана правомерность использования соотношения Тауца [7]. Оптическая ширина запрещенной зоны E_g наноразмерных пленок Ge₂Sb₂Te₅ в области их толщин от 22 до 15 нмувеличиваласьот 2,01 до 2,09 эВ [6].

Наблюдаемое увеличение ширины запрещенной зоны пленок $Ge_2Sb_2Te_5$ с уменьшением их толщины от ~ 100 нм, по-видимому, связанно с уменьшением плотности электронных состояний, формирующих края разрешенных энергетических зон (валентной зоны E_v и зоны проводимости E_c).

Заключение

Наноразмерные пленки Ge₂Sb₂Te₅, полученные методом ионно-плазменного магнетронного распыления, являются сплошными и меют типичную аморфную структуру с ближнем порядком.

Для наноразмерных пленок $Ge_2Sb_2Te_5$ при энергиях фотонов в области края фундаментального поглощения выполняется соотношение Тауца $\alpha hv \sim (hv - E_g)^2$, соответствующее непрямым оптическим переходам.

Установлено, что оптическая ширина запрещенной зоны наноразмерных пленок Ge₂Sb₂Te₅ существенно увеличивается с уменьшением их толщины, что, по-видимому, связанно с уменьшением плотности электронных состояний, формирующих края разрешенных энергетических зон.

Исследования проведены в рамках гранта 4607/ГФ4 Комитета Науки МОН РК

Литература

1 Neale R Amorphous Non-Volatile Memory: the Past and the Future // Eng. - 2001. April. - P. 61-74.

2 Cai B., Drabold D.A., and. Elliott S.R. Structural fingerprints of electronic change in the phase-change-material: $Ge_2Sb_2Te_5$ // Applied Physics Letters. – 2010. – Vol.97.

3 Богословский Н.А., Цэндин К.Д. Физика эффектов переключения и памяти в халькогенидных стеклообразных полупроводниках //ФТП –2012. – Т.46, №5.- С.577-607.

4 Zakery A., Elliott S.R. Optical Nonlinearities in Chalcogenide Glasses and their Applications / Ed.W.T.Rhodes.-Ger.: Springer, 2007. -209 p.

5 Dzhurkov V., Fefelov S., Arsova D., Nesheva D., Kazakova L. Electrical conductivity and optical properties of telluriumrich Ge-Sb-Te films // Journal of Physics. –2014. –Vol.558. –P.012046.

6 Yao H.B., Shi L.P., Chong T.C., Tan P.K., Miao X.S. Optical Transition of Chalcogenide Phase-Change Thin Films // Jpn. J. Appl. Phys. – 2003. – Vol.42. – P.828–831.

7 Tauc J., Grigorovici R. and A. Vancu // Phys. Status Solidi. - 1966. - Vol.15. - P.627.

References

1 R. Neale, Eng. April, 61-74, (2001).

2 B. Cai, D.A. Drabold, and S.R. Elliott, Applied Physics Letters, 97 (2010).

3 N.A. Bogoslovskiy and K.D. Tsendin, FTP, 46(5), 577-607, (2012). (in russ).

4 A. Zakery and S.R. «Elliott Optical Nonlinearities in Chalcogenide Glasses and their Applications», Ed.W.T.Rhodes. (Springer, 2007, 209 p).

5 V. Dzhurkov, S. Fefelov, D. Arsova, D. Nesheva, L. Kazakova, Journal of Physics, 558, 012046, (2014).

6 H.B. Yao, L.P. Shi, T.C. Chong, P.K. Tan, X.S. Miao, Jpn. J. Appl. Phys., 42, 828–831, (2003).

7 J. Tauc, R. Grigorovici, and A. Vancu, Phys. Status Solidi 15, 627 (1966).